

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年5月15日(2008.5.15)

【公開番号】特開2002-308978(P2002-308978A)

【公開日】平成14年10月23日(2002.10.23)

【出願番号】特願2001-118374(P2001-118374)

【国際特許分類】

C 08 G 64/16 (2006.01)

【F I】

C 08 G 64/16

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月2日(2008.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

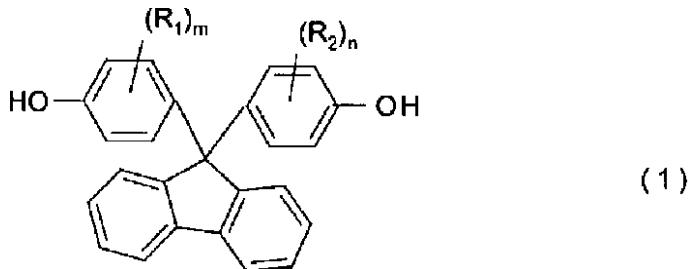
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

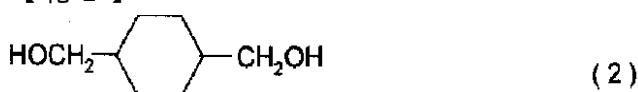
【請求項1】一般式(1)、一般式(2)及び一般式(3)と、炭酸エステル形成化合物とを反応させて得られるポリカーボネートであって、一般式(1)/一般式(2)のモル比が70/30~5/95であり、一般式(3)/(一般式(1)+一般式(2))のモル比が0/100~50/50であるコポリカーボネート樹脂。

【化1】

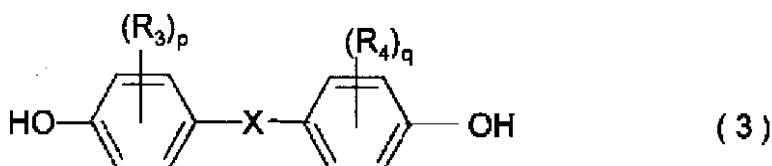


(式中、R₁ ~ R₂は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数6~20のシクロアルキル基、炭素数6~20のシクロアルコキシル基または炭素数6~20のアリールオキシ基を示す。また、m及びnは0~4の整数を表す。)

【化2】

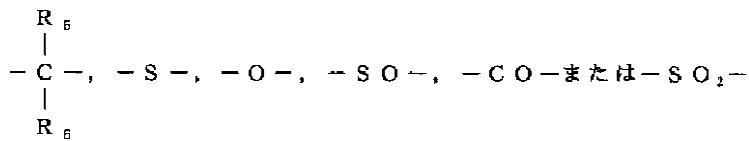


【化3】



(式中、R₃～R₄は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のアルコキシリル基、炭素数6～20のシクロアルキル基、炭素数6～20のアリール基、炭素数6～20のシクロアルコキシリル基または炭素数6～20のアリールオキシ基を表す。またp及びqは、0～4の整数を表す。Xは、

【化4】



であり、R₅～R₆は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数1～10のアルキル基または炭素数6～10のアリール基であり、R₅とR₆とが結合して炭素数3～8の炭素環または複素環を形成する基を表し、これらの基に炭素原子を有する場合には置換基として、炭素数1～5のアルキル基、炭素数2～5のアルケニル基、炭素数1～5のアルコキシ基を有することもできる。)

【請求項2】一般式(3)中のR₅及びR₆がメチル基である請求項1記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項3】前記の一般式(1)、一般式(2)及び一般式(3)と炭酸ジエステルとを、塩基性化合物触媒下、溶融重縮合させてなる請求項1記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項4】前記の一般式(1)、一般式(2)及び一般式(3)の合計量1モルに対して、10⁻⁹～10⁻³モルの塩基性化合物からなる触媒を用いる請求項3記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項5】一般式(1)で表される芳香族ジヒドロキシ化合物のR₁及びR₂がメチル基である請求項3記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項6】光学材料用の請求項1記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項7】光ディスク用の請求項1記載のコポリカーボネート樹脂。

【請求項8】プラスチックレンズ用の請求項1記載のコポリカーボネート樹脂。